WEST

Generate Collection Print

L13: Entry 30 of 39

File: JPAB

Aug 27, 1993

PUB-NO: JP405217211A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05217211 A

TITLE: PHASE CHANGE OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: August 27, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YOSHIO, TOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RICOH CO LTD

APPL-NO: JP04017703

APPL-DATE: February 3, 1992

US-CL-CURRENT: 369/283

INT-CL (IPC): G11B 7/24; B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a phase change <u>optical recording medium</u> having satisfactory recording, vanishing and repeating characteristics.

CONSTITUTION: This phase change optical recording medium has a protective layer 2, an optical recording layer 3 contg. at least silver, a protective layer 4 and a heat radiating layer 5 on a substrate 1. Each of the protective layers 2, 4 consists of two layers, the protective layers 2-2, 4-2 adjacent to the optical recording layer 3 are made of AIN, Si3N4, SiC, etc., and the outer protective layers 2-1, 4-1 are made of ZnS or ZnS-SiO2.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-217211

(43)公開日 平成5年(1993)8月27日

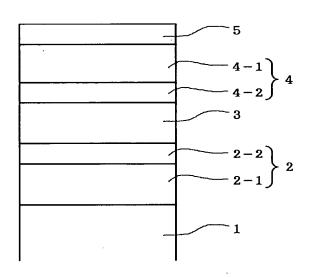
(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	广内整理番号	FΙ			技術表示箇
G11B	7/24	5 3 6	7215-5D				,
B 4 1 M	5/26						
G 1 1 B	7/24	5 1 1	7 215—5D				
		·	8305-2H	B 4 1 M	5/ 26		W
				•	審査請求	未請求	請求項の数1(全 3 頁
(21)出願番号	•	特願平4-17703	(71)出願人 000008747				
					株式会	吐リコー	
(22)出願日		平成4年(1992)2		東京都	大田区中人	馬込1丁目3番6号	
	•			(72)発明者	吉尾	利彦	
					島取県	島取市北村	付10番地3 リコーマイク
					ロエレ	クトロニ	クス株式会社内
				(74)代理人	弁理士	小松 3	秀岳 (外2名)
			•				
				·			
		•					

(54) 【発明の名称 】 相変化型光記録媒体

(57)【要約】

【目的】 良好な記録、消去および繰り返し特性を有する相変化型光記録媒体を提供すること。

【構成】 基板1上に、少なくとも銀を含有する光記録 層4、保護層4および放熱層5を有する相変化型光記録 媒体であって、保護層4が2層からなり、光記録層4に 隣接した保護層2-2と4-2がA1N、SiN、Si C等であり、外側の保護層2-1、4-1がZnSあるいはZnS・SiO2である相変化型光記録媒体。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、少なくとも、銀を含有する光記録層、保護層および放熱層を備え、光記録層に光エネルギーを照射することによって、情報の記録、再生、消去を行う、相変化型光記録媒体において、保護層が2層からなり、光記録層に隣接した保護層が窒化物または炭化物であり、その外側の保護層が硫化亜鉛または硫化亜鉛を含む複合化合物であることを特徴とする相変化型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、書き換え可能な相変化型光記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】書き換え可能な光記録媒体には、相変化型光記録媒体と光磁気型光記録媒体とがある。相変化型光記録媒体の模式断面図を図2に示す。光記録層3はレーザー照射により、溶融、半溶融状態を経て、アモルファス化し、反射率の違いにより情報の記録を行う。この際、光記録層3の溶融、半溶融状態に伴う光記録層の蒸20発変形の防止、大気雰囲気等からの保護、あるいは、基板への断熱の目的で保護層2、4により光記録層を挟むことが一般に行われている(特開昭63-103453(松下)ZnS・SiO2その他の混合物より成る保護層)。しかしながら、前記従来技術には、以下のような問題点があった。

【0003】保護層としてZnS・SiO2等の"S"を含む化合物を使用する場合、剥離、クラック等の欠陥を生ずることなく、数千オングストロームの厚さまで成膜することができ、さらに熱膨脹率が低く、しかも断熱 30性に優れているが、化合物に含まれる"S"と、記録層中のAgとの結合エネルギーが大きいために、図2に示す従来の層構成をとった場合、記録層組成が変化するため、光記録媒体の記録、消去および繰返し特性の劣化という問題が発生する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来技術における上記問題点を解消し、良好な記録、消去および繰返し特性を有する相変化型光記録媒体を提供しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するための本発明の構成は、特許請求の範囲に記載のとおりの相変化型光記録媒体である。

【0006】具体的に説明すると基板1上に第1の保護 層2、Agを含む光記録層3、第2の保護層4および放 熱層5が順次形成され、前記光記録層3へのレーザー光 の照射によって生じる可逆的相変態を利用して情報の記 録、再生および消去を行う相変化型光記録媒体におい て、前記第1および第2の保護層がAgを含む光記録層50 る。

3側に隣接したSiNあるいは、AIN、SiC等のチッ化物、炭化物層とAgを含む記録層と反対側のZnS・SiO2等のSを含む化合物層からなることを特徴とする相変化型光記録媒体である。

【0007】図1は、本発明による相変化型光記録媒体の一構成例を示す断面図であり、透明基板上1に第1の保護層2、光記録層3、第2の保護層4および放熱層5からなり、さらに第1の保護層および第2の保護層は光記録層に隣接する保護層2-1,4-1とAgを含む光10記録層と反対側に成膜される保護層2-2,4-2からなる。

【0008】基板1には、光透過性に優れ、耐熱性や耐 候性、耐薬品性に優れた材質が好ましい。プラスチック やガラスはこの要求を満たしており、プラスチックはト ラッキング用の案内溝やピットが2P法又は射出成形で 簡単にしかも安価に形成でき、ガラスは密着露光法のド ライエッチング等でトラッキング用の溝やピットを形成 できる。プラスチックを用いる場合、特にポリカーボネ ートやアモルファスのポリオレフィン等の材質が好まし く使用される。基板1上に設ける第1の保護層2は、本 発明の特徴となるものであり、保護層2-1および保護 層2-2からなり、外界の湿気などによるAgを含む光 記録層の腐食を防止するパッシベーション効果と、レー ザー照射に伴う蒸発・変形の防止および基板への断熱を 目的としている。保護層2-1には数千オングストロー ムの厚さまで剥離、クラック等の欠陥の発生を有さず成 膜可能であり、しかも熱膨脹率が低く、断熱性にも優れ ているZnS・SiO₂等が使用され、保護層2-2に は、光記録層に含まれるAgとの結合エネルギーが小さ い元素のみを含むSiN、SiC、AlN等が使用され る。第1の保護層2の成膜にはスパッタ法、蒸着法が使 用され、保護層2-1、保護層2-2はそれぞれ100 0~3000Å, 50~500Åの膜厚に形成される。 【0009】光記録層3にはSe, Te, 等のカルコゲ ン族元素を少なくとも1種類以上と、Agを含む合金が 使用され、このような合金として例えばAgInTeS bなどがある。この光記録層3は、スパッタ法、蒸着法 により、200~2000 Aの膜厚が形成される。

【0010】第2の保護層4は、第1の保護層同様本発 40 明の特徴となるものであり、保護層4−1および保護層 4−2からなる。保護層4−1にはZnS・SiO₂等 が使用されまた保護層4−2にはSiN、SiC、Al N等が使用される。第2の保護層の成膜には、スパッタ 法、蒸着法が使用され、保護層4−1、保護層4−2は それぞれ1000~3000Å、50~500Åの膜厚 に形成される。

【0011】放熱層5は、熱伝導率の高いA1あるいはA1合金が一般に使用される。放熱層5は、スパッタ法、蒸着法等により200Å~2500Åに成膜され

【0012】以上本発明による一構成例について述べてきたが、本発明はこの構成例のみに限定されるものではなく、例えば、反射層5の上に有機カバー層を設けたり、接着層を介して媒体を貼り合せ両面記録型とするなど、種々の変形、変更が可能である。

[0013]

【実施例】図1に示すように、ポリカーボネイト製基板 1上にZnS・SiO2ターゲットを使用し、Ar雰囲 気中にてZnS・SiO2からなる保護層2-1をスパッタ成膜し、その上にSiターゲットを使用し、Arと 10 N雰囲気中でSiNからなる保護層2-2をスパッタ成 膜した。

【0014】光記録層3は、Ag: In: Te: Sbの 原子比が1:1:2:4であるターゲットを使用し、A r雰囲気中にて成膜した。

【0015】保護層4-1は保護層2-1と同様に、また保護層4-2は保護層2-2と同様に成膜した。

【0016】放熱層はA1-7wt%Tiターゲットを使用し、Ar雰囲気中で成膜した。それぞれの各膜厚は、保護層2-1が2000Å、保護層2-2が100 20 Å、光記録層が1000Å、保護層4-1が1000 Å、保護層4-2が100Å、反射放熱層5は500Åとした。

【0017】比較例として、図2に示される層構成を有するデイスクを作製した。保護層2、保護層4はともに $ZnS \cdot SiO_2$ であり、膜厚はそれぞれ2000Å、1000Åとした。光記録3および放熱層5は実施例と同様とした。

【0018】以上本発明による一構成例について述べてきたが、本発明はこの構成例のみに限定されるものでは 30なく、例えば、反射層5の上に有機カバー層を設けたり、接着層を介して媒体を貼り合せ両面記録型とするなど、種々の変形、変更が可能である。

【0019】各デイスクは、レーザー照射により、10 mwで初期化を行った後、ライトパワー12mw, バイアス6mwで記録、消去を繰り返し、記録特性が45d B以上, 消去比25dB以上が保たれる繰り返し回数を測定した。

【0020】その結果、実施例のデイスクは10万回以上の繰り返しが可能であったが、比較例のデイスクは1万5千回程度の繰り返しにより記録特性、消去比ともにそれぞれ45dB、25dB以下に低下した。

10 【0021】また初期記録特性および消去比は実施例で それぞれ50dB、および40dBであったのに対し、 比較例では、それぞれ49dB、38dBであった。 【0022】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によればA gを含む光記録層をもつ相変化型光記録媒体において、保護層を2層としAgを含む光記録層側をSiN,SiC,A1N等のチツ化物,炭化物化合物とし、そのが外側をZnSあるいはZnSを含む化合物とすることにより記録、消去特性、繰り返し特性を改善した。

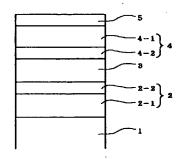
20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光記録媒体の構成を示す断面の模式 図

【図2】従来の光記録媒体の構成を示す断面の模式図。 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 保護層
- 2-1 保護層
- 2-2 保護層
- 3 光記録層
- 30 4 保護層
 - 4-1 保護層
 - 4-2 保護層
 - 5 放熱層

【図1】



【図2】

